# (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

# 特開平5-210049

(43)公開日 平成5年(1993)8月20日

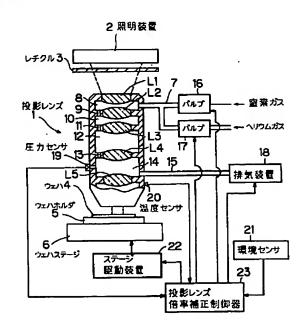
(51) Int.Cl. <sup>5</sup>		識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
G 0 2 B	15/00		8106-2K		
	3/12		8106-2K		
G03B	27/32	F	9017-2K		
	27/34		9017-2K		
			7352-4M	H01L	21/30 3 1 1 L
				審査請求 未請求	! 請求項の数4(全 6 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号		<b>特顧平4-16457</b>	-	(71)出願人	000005821
			ζ.		松下電器産業株式会社
(22)出願日		平成4年(1992)1/	₹31日		大阪府門真市大字門真1006番地
		•		(72)発明者	青木新一郎
	•		÷		神奈川県川崎市多摩区東三田3丁目10番1
					号 松下技研株式会社内
				(72)発明者	中 西 淑 人
				'	神奈川県川崎市多摩区東三田3丁目10番1
					号 松下技研株式会社内
				(74)代理人	弁理士 蔵合 正博
			•		
			•		
	•				

# (54) 【発明の名称】 投影レンズ倍率補正方法およびその装置

# (57)【要約】

【目的】 レチクル上のパターンを投影光学系を介して ウェハ上に投影露光するための投影レンズの倍率を環境 が変化しても一定に保つこと。

【構成】 投影レンズ1に対して2種類以上の屈折率の 異なる例えば窒素ガスとヘリウムガスを投影レンズ1の レンズ間に供給して、圧力センサ19、温度センサ20 および環境センサ21からの検出値を投影レンズ倍率補 正制御器23に取り込み、計算した結果からパルプ1 6,17を制御して投影レンズ1内のガスの混合率およ び圧力を変えることにより、投影レンズ1の屈折率を変 化させてその倍率を補正する。



1

#### 【特許請求の筑囲】

【請求項1】 レチクル上のパターンを投影光学系を介 してウェハ上に投影露光するための投影レンズのレンズ 間に屈折率の異なる2種類以上のガスを供給し、前配ガ スの混合率を変えることにより投影レンズの屈折率を変 化させてその倍率を補正する投影レンズ倍率補正方法。

【 
聞求項2 
】 レチクル上のパターンを投影光学系を介 してウェハ上に投影解光するための投影レンズに対し て、屈折率の異なる2種類以上のガスを投影レンズのレ ンズ間に供給するためのガス供給手段と、この混合ガス 10 ジ103をX, Y, 2方向に駆動するステージ駆動装 を投影レンズ外に排出するためのガス排出手段と、混合 ガスを構成するそれぞれのガスの流量を制御してその混 合率および圧力を可変するためのバルブとを備えた投影 レンズ倍率補正装置。

【請求項3】 投影レンズ内のガス圧力を検出する圧力 センサと、投影レンズ外の気圧を検出する環境センサ と、これらのセンサからの検出値を基に投影レンズ内の ガス混合率およびその圧力を制御する投影レンズ倍率補 正制御器とを備えた請求項2記載の投影レンズ倍率補正 装置。

【請求項4】 投影レンズ内の温度を検出する温度セン サを備え、その検出値を投影レンズ倍率補正制御器にお ける倍率補正の際の要素とする請求項3記載の投影レン ズ倍率補正装置。

## 【発明の詳細な説明】

# [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、半導体集積回路等の製 造に要する微細レジストパターンを形成するための投影 露光装置の投影レンズ倍率補正方法およびその装置に関 するものである。

### [0002]

【従来の技術】近年、投影露光装置は、半導体集積回路 の高集積化に伴い、ますます微細なパターンの作成が必 要になってきている。特に、64Mピットメモリーやそ れ以上の微細なパターンを形成する際には、露光を行な うための投影レンズの開口数が解像するパターンに関係 するため、投影レンズの口径が次第に大きくなってきて おり、これに伴って烏点深度が茂くなり、レンズ内外の 圧力変動や温度変化によって焦点面がずれてしまい、微 細なパターンが作成できなくなってきた。これに対処す 40 n=q(p)るため、圧力や温度等の環境変化があっても投影レンズ の倍率を一定に保つための投影レンズ倍率補正装置が、 例えば特開昭60-79357号公報等に開示されてい

【0003】図2はこのような従来の投影レンズ倍率補 正装置の構成を示すものである。図2において、101 は投影レンズ、102は照明装置、103はウェハステ ージである。104は空気供給源、105は空気のダス トを集座するフィルター、106は供給する空気の流量 を可変するパルプ、107は投影レンズ101への空気 50 間隙112、通気孔113、間隙114と通過して空気

の各レンズレ1~レ5間の間隙、109, 111, 11 3は各レンズL1~L5間の間隙をつなぐ通気孔、11 5は投影レンズ101内の空気を排出する空気排出管、 116は排出する空気の流量を可変するパルプ、117 は排気装置、118は投影レンズ101内の圧力を検出 する圧力センサ、119は投影レンズ101内の温度を

供給管、108, 110, 112, 114は投影レンズ

検出する温度センサ、120は投影露光装置内の気圧お よび温度を検出する環境センサ、121はウェハステー 置、122はインタフェース、123はキーポード、1 24はタイマー回路、125は装置全体を制御するCP U、126は投影レンズ101と照明装置102との間 に配置されたレチクル、127はウェハステージ103

【0004】以上のように構成された投影レンズ倍率補 正装置について、以下その動作について説明する。ま ず、照明装置102によって照明されたレチクル126 の原画パターンを、投影レンズ101により、ウェハス 20 テージ103上に载置されたウェハ127上に縮小して 結像する。そして、ウェハステージ103をステージ駆 動装置121によりX、Yの水平方向に2次元に走査す ることにより、レチクル126の原画パターンを多数露

上に载置されたウェハである。

【0005】投影レンズ101の焦点距離は、概略1μ m以下のため、ウェハステージ103は、ステージ駆動 装置121により2の上下方向にも動作可能であり、ウ ェハ127に焦点が合うように制御される。一般的に は、ウェハステージ103を上下方向に少しずつ変えて 30 露光し、一番焦点が合ったところに固定して、以降続け て踩光していく。

【0006】ところが、実際に露光を続けていくと、徐 々に作業環境が変化していく。すなわち、外部の気圧や 温度によって空気の屈折率が変化し、投影レンズ101 の倍率と焦点位置が微妙にずれてくる。実験的には倍率 a、焦点距離sは、屈折率nと温度tの関数、

a=f(n, t) s=g(n, t)

の関係式が成立つ。また空気の屈折率n(n=1.00 0292) は気圧pとの関係式、

が成立つので、 a=f(q(p), t),(q (p), t)となる。

【0007】ここで、圧力センサ118、温度センサ1 19および環境センサ120をCPU124に取込ん で、倍率 a が変化しないようにパルプ106、116を 制御して供給する空気の量をコントロールする。 パルプ 106を開けた場合、空気は空気供給管107を通って 投影レンズ101のレンズ間の間隙108に流入する。 そこから、通気孔109、間隙110、通気孔111、

10

排出管115から排出される。空気排出管115の先に はパルプ116があり、排気装置117への排気量をコ ントロールする。これにより、投影レンズ101の内部 は、指定する圧力に保つことができるため、倍率の移動 を最小限に保つことが可能となる。また焦点移動につい ては、あらかじめシュミレーションした結果をもとにウ ェハステージ103を制御する。

#### [0008]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記の 従来の構成では、投影レンズ101内の圧力を可変制御 することによって、投影レンズ101の投影倍率を一定 に保つ方式であるため、例えば外部の気圧が大きく低下 した場合に投影レンズ101の圧力を高める制御を行な ったとき、その圧力によってレンズL1~L5が微視的 に撓む場合があり、その結果、ウェハ上に結像するはず の焦点位置にずれが生じたり、結像した像に歪が生じて しまうという問題があった。

【0009】本発明は、このような従来の問題を解決す るものであり、焦点の位置ずれや結像の歪なしに、投影 レンズの像倍率を一定に保つことができる投影レンズ倍 20 率補正方法およびその装置を提供することを目的とす

#### [0010]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、本発明による投影レンズ倍率補正方法は、レチクル 上のパターンを投影光学系を介してウェハ上に投影露光 するための投影レンズのレンズ間に屈折率の異なる2種 類以上のガスを供給し、その混合率を変えることにより 投影レンズの屈折率を変化させてその倍率を補正するよ うにしたものである。

【0011】また、本発明による投影レンズ倍率補正装 置は、レチクル上のパターンを投影光学系を介してウェ ハ上に投影露光するための投影レンズに対して、屈折率 の異なる2種類以上のガスを投影レンズのレンズ間に供 給するためのガス供給手段と、この混合ガスを投影レン ズ外に排出するためのガス排出手段と、混合ガスを構成 するそれぞれのガスの流量を飼御してその混合率および 圧力を可変するパルプとを備えたものである。

【0012】本発明はまた、投影レンズ内のガス圧力を 検出する圧力センサと、投影レンズ外の気圧を検出する 40 環境センサと、これらのセンサからの検出値を基に投影 レンズ内のガスの混合率およびその圧力を制御する投影 レンズ倍率補正制御器とを備えたものである。

#### [0 0 1 3]

【作用】本発明は、上記構成により、圧力センサおよび 環境センサからの検出値を投影レンズ倍率補正制御器に 取り込んで計算し、その結果に基づいてパルブを制御 し、投影レンズ内のガスの混合率を変えることにより、 投影レンズの屈折率を指定の値に制御するようにしたも 

率の移動を最小限に保つことができ、従来のような投影 レンズ内外に圧力差が生じることがないので、レンズに 撓みを生じさせることもなく、歪のない正確な像を結像

### [0014]

させることができる。

#### 【実施例】

(実施例1)以下、本発明の一実施例について、図面を 参照しながら説明する。図1は本発明の一実施例におけ る投影レンズ倍率補正装置の構成図である。図1におい て、1は投影レンズ、2は照明装置、3はレチクル、4 はウェハ、5はウェハホルダ、6はウェハステージであ る。7は図示されないガス供給装置とともにガス供給手 段を構成する投影レンズ1へのガス供給管、8,10, 12.14は投影レンズの各レンズL1~L5間の間 隙、9、11、13は各レンズL1~L5間の間隙をつ なぐ通気孔、15は投影レンズ1内のガスを排出するガ ス排出管、16は第1のガスである窒素ガス(屈折率 n nは1.000297) の流量を可変するパルプ、17 は第2のガスであるヘリウムガス(屈折率nhは1.0 00035) の流量を可変するパルプ、18はガス排出 管15とともにガス排出手段を構成する排気装置、19 は投影レンズ1内の圧力を検出する圧力センサ、20は 投影レンズ1内の温度を検出する温度センサ、21はこ の装置内の気圧および温度を検出する環境センサ、22 はウェハステージ6をX、Y、Z方向に駆動するステー ジ駆動装置、23はこの装置全体を制御する投影レンズ 倍率補正制御器である。

【0015】以上のように構成された投影レンズ倍率補 正装置について、以下その動作について説明する。ま 30 ず、照明装置1によって照明されたレチクル3の原画パ ターンは、投影レンズ1により、ウェハホルダ5に载置 されたウェハ4上に縮小して結像される。そして、ウェ ハステージ6をステージ駆動装置22によりX, Yの水 平方向に2次元に走査することにより、レチクル3の原 画パターンを多数露光する。また、投影レンズ1の焦点 合わせは、ウェハステージ6をステージ駆動装置22に より2の上下方向に移動させ、ウェハ4に焦点が合うよ うに倒御する。

【0016】窒素ガスとヘリウムガスは、それぞれ投影 レンズ倍率補正制御器23によりコントロールされた流 量パルプ16,17を通ってガス供給管7から投影レン ズ1内に供給され、レンズL1とL2との間の間隙8に 流入する。そこから、通気孔9、間隙10、通気孔1 1、間隙12、通気孔13、間隙14と通過してガス排 出管15を通って排気装置18により排出される。

【0017】投影レンズ1の屈折率naは、パルプ1 6. 17によって、窒素ガスとヘリウムガスの混合率を 任意に変えることによって調整することができる。すな わち、実験的には投影レンズ1の倍率 a a および焦点距

-417-

aa=f(n, v(nn, nh), t)sa=g(n, v(nn, nh), t)

の関係式が成り立つ。ここでnは空気の屈折率、v(n n. nh) は窒素ガスとヘリウムガスの混合率の合成屈 折率 (合成屈折率は1.000035から1.0002 97まで可変可能)の関数である。空気の屈折率nは、 レチクル3と投影レンズ1の間と、ウェハ4と投影レン ズ1の間にある空気に関するものである。また空気の屈 折率n (n=1.000292) は気圧pとの関係式、 n=q(p)

が成り立つので、 a = f(q(p), t)f (q (p), t)となる。

【0018】したがって、圧力センサ19、温度センサ 20および環境センサ21からの検出値を投影レンズ倍 率補正制御器21に取り込み、上記式で計算した結果に 基づいてパルプ16,17を制御し、投影レンズ1内の ガスの混合率およびその圧力を変えることにより、投影 レンズ1の屈折率を指定の値に制御する。これにより、 環境の変化があった場合にも、倍率の移動を最小限に保 つことができる。また焦点移動については、あらかじめ 20 装置の概略構成図 シュミレーションした結果をもとにステージ駆動装置2 2によりウェハステージ6を制御する。この結果、投影 レンズ1内の圧力は外部の圧力に近い圧力に保つことが できるため、従来のように投影レンズ1内の圧力が外気 圧に対して変動することがなく、その圧力差によって投 影レンズ1内のレンズが歪んでしまうこともなく、投影 レンズ1の倍率を一定に保つことができる。

【0019】なお、上記実施例において、投影レンズ1 内の温度が常に一定に保たれるように投影露光装置自体 が制御されている場合には、本装置に温度センサ20を 30 8, 10, 12, 14 間隙 設けることは必ずしも必要なことではない。

#### [0020]

【発明の効果】以上のように、本発明による投影レンズ 倍率補正方法によれば、レチクル上のパターンを投影光 学系を介してウェハ上に投影露光するための投影レンズ のレンズ間に屈折率の異なる2種類以上のガスを供給 し、その混合率を変えることにより投影レンズの屈折率 を変化させてその倍率を補正するようにしたので、従来 のような投影レンズ内外の圧力差によって投影レンズ内 のレンズが撓んだりすることがなく、歪のない正確な像 40 L1~L5 レンズ

を結像させることができる。

【0021】また本発明による投影レンズ倍率補正装置 によれば、レチクル上のパターンを投影光学系を介して ウェハ上に投影露光するための投影レンズに対して、屈 折率の異なる2種類以上のガスを投影レンズのレンズ間 に供給して、圧力センサおよび環境センサからの検出値 を投影レンズ倍率補正制御器に取り込み、計算した結果 からパルプを制御して投影レンズ内のガスの混合率およ び圧力を変えるようにしたので、投影レンズの屈折率を 10 指定の値に制御することができ、環境の変化があった場 合にも投影レンズの倍率の移動を最小限に保つことがで きる。この結果、投影レンズ内の圧力は外部の圧力に近 い圧力に保つことができるため、従来のような投影レン ズ内の圧力が外部に対して変動することがなく、したが ってその圧力差によって投影レンズ内のレンズが撓んで しまうこともなく、歪のない正確な像を結像させること ができる。

ĥ

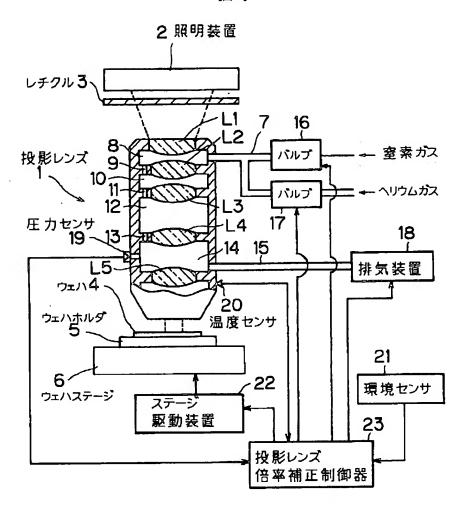
#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例における投影レンズ倍率補正

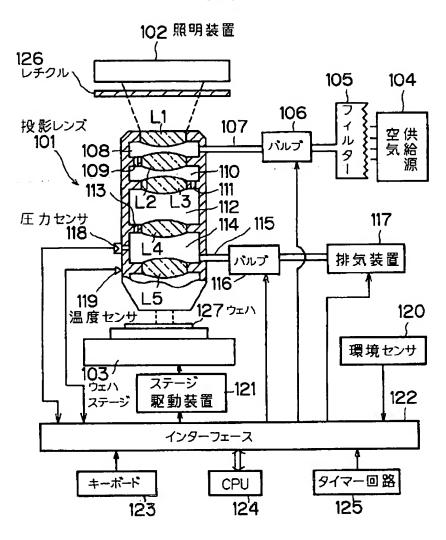
【図2】従来の投影レンズ倍率補正装置の概略構成図 【符号の説明】

- 1 投影レンズ
- 2 照明装置
- 3 レチクル
- 4 ウェハ
- 5 ウェハホルダ
- 6 ウェハステージ
- 7 ガス供給管
- - 9, 11, 13 通気孔
  - 15 ガス排出管
  - 16, 17 パルプ
  - 18 排出装置
  - 19 圧力センサ
  - 20 温度センサ
  - 21 環境センサ
  - 22 ステージ駆動装置
  - 23 投影レンズ倍率補正制御器

【図1】



【図2】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 5

識別記号 521 庁内整理番号 7818-2H

FΙ

技術表示箇所

G03F 7/20 H01L 21/027